

以雷射剝離法研製淡化銦鎵垂直共振腔發光二極體

黃詩詠、武東星；姚品全

E-mail: 9419807@mail.dyu.edu.tw

摘要

目前垂直共振腔發光二極體主要應用於短距離資料傳輸的塑膠光纖上，原因在於垂直共振腔發光二極體有著較傳統發光二極體半高寬窄、指向性佳、以及發光效率高等之優點。垂直共振腔發光二極體結構組成主要由有機金屬化學氣相沉積系統成長氮化銦鎵/氮化鎵多重量子井層，並介於兩面反射率各為85%(5對)與99.9%(7.5對)之介電質(TiO₂/SiO₂)分佈式布拉格反射鏡之間，且在我們欲製作之波段525nm左右，有很寬之高反射率截止區(Stopband)。實驗結果顯示，在20 mA直流電流注入下，垂直共振腔發光二極體與傳統發光二極體之起始電壓值幾乎相符各為4.55V與4.45V。在525 nm的垂直共振腔發光二極體有較穩定之發光波長，由於電流密度增加時有較少的熱效應因而紅移量減少，且共振腔模態之半高寬為5.5 nm較傳統發光二極體之指向性更好，發光波長之半高寬由48降為35 nm，並得到約為100之品質因數。垂直共振腔發光二極體之電激發光譜有較強的光輸出，這是由於共振腔的影響之故，並且由不同角度之電激發光分析量測中證明發光方向有獲得改善。

關鍵詞：氮化鎵、氮化銦鎵、垂直共振腔發光二極體

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
iv 英文摘要	v 謹謝
vi 目錄	vii 圖目錄
x 第一章 緒論	1 1.1
前言	1 1.2研究背景與動機
原理	8 2.1駐波
工作原理	8 2.3品質因數(Quality Factor)與Finesse參數
鏡之工作原理	11 2.4 分佈式布拉格反射
12 2.5介電質分佈式布拉格反射鏡之設計原理	14 2.5.1四分之一波膜堆反射鏡
15 第三章 實驗步驟	28 3.1實驗流程
28 3.1.1第一道製程-定義元件尺寸大小(Mesa)	29 3.1.2第二道製程-透明導電層(Transparent Conductive Layer TCL)
30 3.1.3第三道製程-絕緣層(Insulating Layer)	31 3.1.4第四道製程-正負電極(P and N Electrode)
31 3.1.5第五道製程-雷射剝離製程	32 3.1.6第六道製程-下介電質分佈式布拉格反射鏡之製作
33 3.1.7第七道製程-晶圓貼合製程	33
34 3.1.8第八道製程-上介電質分佈式布拉格反射鏡之製作	34 3.2 N & K光學量測系統(N & K Analyzer)
35 3.3原子力顯微鏡量測儀(AFM)	35 3.4掃描式電子顯微鏡(SEM)
36 3.5電性量測系統	37 3.6光激發光光譜量測系統(PL)
38 3.7電激發光光譜量測系統(EL)	39 第四章 實驗結果與討論
51 4.1雷射剝離技術之研討	51 4.1.1雷射剝離後之氮化鎵表面
51 4.1.2雷射剝離後之氮化鎵表面粗糙度	52 4.1.3雷射剝離前後光激發光頻譜圖
52 4.2全介電質共振腔發光二極體之電特性量測	52 4.2全介電質共振腔發光二極體之電激發光曲線圖之研討
53 4.3全介電質共振腔發光二極體之調變上反射率之研討	53 4.3.1下介電質薄膜反射率之實際值與模擬值之比較
54 4.3.2上與下介電質布拉格反射鏡的實際反射率疊圖	54 4.3.3介電質反射鏡之場發射掃描式電子顯微鏡剖面圖
55 4.4全介電質共振腔發光二極體之電激發光曲線圖之研討	55 4.3.4介電質薄膜表面輪廓及粗糙度
56 4.5全介電質共振腔發光二極體之變溫量測分析	57 4.6全介電質共振腔發光二極體之電流密度對半高寬曲線圖之研討
57 4.7全介電質共振腔發光二極體之電流密度對波長曲線圖之研討	58 4.8全介電質共振腔發光二極體之光輻射角度對電激發光強度曲線圖之研討
59 4.9全介電質共振腔發光二極體之電流密度對光輸出功率之研討	60 4.10全介電質共振腔發光二極體之可信賴度分析
60 4.10全介電質共振腔發光二極體之可信賴度分析	60 第五章 結論
81 參考文獻	82

【1】 H. Amano, T. Asahi, and I. Akasaki, “ Stimulated Emission Near Ultraviolet at Room Temperature from a GaN Film Grown on Sapphire by MOVPE Using an AlN Buffer Layer, ” Jpn. J. Appl. Phys., vol. 29, no.2, pp. L205-L206, Feb. 1990. 【2】 S. Strite, and H. Morkoc, “ GaN, AlN, and InN: A Review, ” J. Vac. Sci. Technol. vol. B10, no. 4, pp. 1237-1266, Jul/Aug 1992. 【3】 F. Calle1, F. B. Naranjo, S. Ferna ’ ndez, M. A. Sa ’ nchez-Garci ’ a, E. Calleja, and E. Mun?oz, “ Nitride RCLEDs Grown by MBE for POF Applications, ” phys. stat. sol. (a) vol. 192, no. 2, pp. 277-285, March 2002. 【4】 E. F. Schubert, Y.-H. Wang, A. Y. Cho, L.-W. Tu, and G. J. Zydzik, “ Resonant Cavity Light-Emitting Diode, ” Appl. Phys. Lett., vol. 60, no. 8, pp. 921-923, Feb. 1992. 【5】 P. Maaskant, M. Akhter, B. Roycroft, E. O ’ Carroll, and B. Corbett, “ Fabrication of GaN-Based Resonant Cavity LEDs, ” Phys. Stat. Sol. (a) vol. 192, no. 2, pp. 348-353, 2002. 【6】 B. Roycroft, M. Akhter, P. Maaskant, P. de Mierry, S. Ferna ’ ndez, F. B. Naranjo, E. Calleja, T. McCormack, and B. Corbett, “ Experimental Characterisation of GaN-Based Resonant Cavity Light Emitting Diodes, ” Phys. Stat. Sol. (a) vol. 192, no. 1, pp. 97-102, 2002. 【7】 T. Honda, A. Katsube, T. Sakaguchi, F. Koyama, and K. Iga, “ Threshold Estimation of GaN-Based Surface Emitting Lasers Operating in Ultraviolet Spectral Region, ” Jpn. J. Appl. Phys., vol. 34, no.7A, pp. 3527-3532, July 1995. 【8】 S. P. DenBaars, “ Blue and Green InGaN VCSEL Technology, ” Department of Materials University of California, Santa Barbara, California, 93106, Final Report 1998-99 for MICRO Project 98-034. 【9】 Y.-K. Song, H. Zhou, M. Diagne, I. Ozden, A. Vertikov, and A. V. Nurmikko, “ A Vertical Cavity Light Emitting InGaN Quantum Well Heterostructure, ” Appl. Phys. Lett. vol. 74, no. 23, pp. 3441-3443, Jun. 1999. 【10】 Y.-K. Song, M. Diagne, H. Zhou, A. V. Nurmikko, R. P. Schneider, Jr., and T. Takeuchi, “ Resonant-Cavity InGaN Quantum-Well Blue Light-Emitting Diodes, ” Appl. Phys. Lett. vol. 77, no. 12, pp. 1744-1746, Sep. 2000. 【11】 H. Benisty, H. De Neve, and C. Weisbuch, “ Impact of Planar Microcavity Effects on Light Extraction—Part I: Basic Concepts and Analytical Trends, ” IEEE J. Quantum Electron., vol. 34, no. 9, pp. 1612-1631, Sep. 1998. 【12】 A. Furukawa, S. Sasaki, M. Hoshi, A. Matsuzono, K. Moritoh, and T. Baba, “ High-Power Single-Mode Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers, ” Appl. Phys. Lett. vol. 85, no. 22, pp. 5161-5163, Nov. 2004. 【13】 I. L. Krestnikov, W. V. Lundin, A. V. Sakharov, V. A. Semenov, A. S. Usikov, A. F. Tsatsul ’ nikov, and Zh. I. Alferov, “ Room-Temperature Photopumped InGaN/GaN/AIGaN Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, ” Appl. Phys. Lett. vol. 75, no. 9, pp. 1192-1194, Aug. 1999. 【14】 B. S. Ryvkin and K. Panajotov, “ Optical-Injection-Induced Polarization Switching in Polarization-Bistable Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers, ” J. Appl. Phys. vol. 96, no. 11, pp. 6002-6007, Dec. 2004. 【15】 F. B. Naranjo, S. Ferna ’ ndez, M. A. Sa ’ nchez-Garci ’ a, F. Calle, and E. Calleja, “ Resonant-Cavity InGaN Multiple -Quantum-Well Green Light-Emitting Diode Grown by Molecular-Beam Epitaxy, ” Appl. Phys. Lett. vol. 80, no. 12, pp. 2198-2200, Mar. 2002. 【16】 P. de Mierry, J. M. Bethoux, H. P. D. Schenk, M. Vaille, E. Feltin, B. Beaumont, M. Leroux, S. Dalmasso, and P. Gibart, “ Vertical Cavity InGaN LEDs Grown by MOVPE, ” Phys. Stat. Sol. (a) vol. 192, no. 2, pp. 335-340, 2002. 【17】 M. Arita, M. Nishioka, and Y. Arakawa, “ InGaN Vertical Microcavity LEDs with a Si-Doped AIGaN/GaN Distributed Bragg Reflector, ” Phys. Stat. Sol. (a) vol. 194, no. 2, pp. 403-406, 2002. 【18】 P.N. Stavrinou, et al., “ Insight into Planar Microcavity Emission as a Function of Numerical Aperture, ” Opt. Commun. vol. 195, pp. 327-338, Aug 2001. 【19】 A. M. Green., D. G. Gevaux, C. Roberts, C. C. Phillips, “ Resonant-Cavity-Enhanced Photodetectors and LEDs in the Mid-Infrared, ” Phys. E, vol.20, pp. 531-535, 2004. 【20】 李正中編著 , “薄膜光學與鍍膜技術” , 藝軒圖書出版社 【21】 S. Sano, T. Detchprohm, S. Mochizuki, S. Kamiyama, H. Amano and I. Akasaki, “ Low-Dislocation-Density GaN and Al_xGa_{1-x}N (x = 0.13) Grown on Grooved Substrates, ” J. Cryst. Growth, vol. 235, pp. 129-134, 2002. 【22】 P. R. Tavernier and D. R. Clarke, “ Mechanics of Laser-Assisted Debonding of Films, ” J. Appl. Phys. vol. 89, no. 3, pp. 1527-1536, Feb. 2001. 【23】 T. Ueda, M. Ishida, S. Tamura, Y. Fujimoto, M. Yuri, T. Saito, and D. Ueda, “ Vertical InGaN-Based Blue Light Emitting Diode with Plated Metal Base Fabricated Using Laser Lift-Off Technique, ” phys. stat. sol. (c) vol. 0, no. 7, pp. 2219-2222, 2003. 【24】 C. F. Chu, F. I Lai, J. T. Chu, C. C. Yu, C. F. Lin, H. C. Kuo, and S. C. Wang, “ Study of GaN Light-Emitting Diodes Fabricated by Laser Lift-Off Technique, ” J. Appl. Phys. vol. 95, no. 8, pp. 3916-3922, Apr. 2004. 【25】 P. Perlin, L. Mattos, N. A. Shapiro, J. Kruger, W. S. Wong and T. Sands, “ Reduction of the Energy Gap Pressure Coefficient of GaN Due To the Constraining Presence of the Sapphire Substrate, ” J. Appl. Phys. vol. 85, no. 4, pp. 2385-2389, Feb. 1999. 【26】 W. S. Wong, Y. Cho, E. R. Weber, and T. Sands, “ Structural and Optical Quality of GaN/Metal/Si Heterostructures Fabricated by Excimer Laser Lift-Off, ” Appl. Phys. Lett. vol. 75, no. 13, pp. 1887-1889, Sep. 1999. 【27】 W. S. Wong and T. Sands, “ Fabrication of Thin-Film InGaN Light-Emitting Diode Membranes by Laser Lift-Off, ” Appl. Phys. Lett. vol. 75, no. 10, pp. 1360-1362, Sep. 1999.